

G03F	フォトメカニカル法による凹凸化又はパターン化された表面の製造, 例. 印刷用, 半導体装置の製造法用; そのための材料; そのための原稿; そのために特に適合した装置(写真植字機 B 4 1 B; 写真用感光材料または処理 G 0 3 C; エレクトログラフイー, そのための感光層または処理 G 0 3 G)		の準備, 例. 光近接効果補正 [O P C] デザインプロセス [2 0 1 2 . 0 1]
		1/38	・補助的な特徴を有するマスク, 例. 特別なコーティング又はアライメント若しくは試験のためのマーク; その準備 [2 0 1 2 . 0 1]
		1/40	・静電放電 [E S D] に関連する特徴, 例. 帯電防止コーティング又はマスク基板の周囲の導電性金属層 [2 0 1 2 . 0 1]
		1/42	・アライメント又は重ね合わせ (レジストレーション) の特徴, 例. マスク基板上のアライメントマーク [2 0 1 2 . 0 1]
		1/44	・試験又は測定の特徴, 例. 格子パターン, フォーカスモニター, のこぎり歯状スケール又はノッチ状スケール [2 0 1 2 . 0 1]
		1/46	・反射防止コーティング [2 0 1 2 . 0 1]
		1/48	・保護コーティング [2 0 1 2 . 0 1]
		1/50	・グループ G 0 3 F 1 / 2 0 から G 0 3 F 1 / 2 6 に含まれないマスクブランク; その準備 [2 0 1 2 . 0 1]
		1/52	・反射材 [2 0 1 2 . 0 1]
		1/54	・吸収材, 例. 不透明な材料 [2 0 1 2 . 0 1]
		1/56	・有機的な吸収材, 例. フォトレジスト [2 0 1 2 . 0 1]
		1/58	・2 つ以上の異なる吸収材層, 例. 積層された複数層の吸収材 [2 0 1 2 . 0 1]
		1/60	・基板 [2 0 1 2 . 0 1]
		1/62	・ペリクル又はペリクル構造体, 例. 支持フレーム上に薄膜を備えるもの; その準備 [2 0 1 2 . 0 1]
		1/64	・そのフレームに特徴のあるもの, 例. その構造又は材料 [2 0 1 2 . 0 1]
		1/66	・容器, 特にマスク, マスクブランク又はペリクルに適合するもの; その準備 [2 0 1 2 . 0 1]
		1/68	・グループ G 0 3 F 1 / 2 0 から G 0 3 F 1 / 5 0 に含まれない準備プロセス [2 0 1 2 . 0 1]
		1/70	・マスクの基本的レイアウト又はデザインをリソグラフィプロセスの要求に適合させること, 例. 画像化のためのマスクパターンの再修正 [2 0 1 2 . 0 1]
		1/72	・マスク欠陥の修理又は修正 [2 0 1 2 . 0 1]
		1/74	・荷電粒子線 [C P B], 例. 集束イオンビーム, によるもの [2 0 1 2 . 0 1]
		1/76	・画像化によるマスクのパターン形成 [2 0 1 2 . 0 1]
注	このサブクラスにおいては, 下記の用語は以下に示す意味で用いる:		
	“感光性”は電磁波に対する感光性のみならず, 粒子線に対する感光性も意味する;		
	“感光性組成物”は感光性物質, 例. キノンジアジド, およびもし適用できれば, 結合剤または添加剤を包含する;		
	“感光材料”は感光性組成物, 例. フォトレジスト, それら支持体およびもし適用できれば, 補助層を包含する。[5]		
1/00	フォトメカニカル法による凹凸化又はパターン化された表面の製造に用いる原稿, 例. マスク, フォトマスク又はレチクル; そのためのマスクブランク又はペリクル; 特にそれに適合した容器; その準備 [3 , 2 0 1 2 . 0 1]		
注	このメイングループでは, ファーストプレイス優先ルールが適用される, すなわち各階層レベルにおいて, 相反する指示がない限り, 最初の適切な箇所に分類する。[2 0 1 2 . 0 1]		
1/20	・荷電粒子線 [C P B] の放射, 例. 電子線, によって画像化するためのマスク又はマスクブランク; その準備 [2 0 1 2 . 0 1]		
1/22	・1 0 0 n m 以下の波長の放射によって画像化するためのマスク又はマスクブランク, 例. X 線マスク, 極端紫外 [E U V] マスク; その準備 [2 0 1 2 . 0 1]		
1/24	・反射マスク; その準備 [2 0 1 2 . 0 1]		
1/26	・位相シフトマスク [P S M]; P S M ブランク; その準備 [2 0 1 2 . 0 1]		
1/28	・同一の P S M 上に3 種以上の位相; その準備 [2 0 1 2 . 0 1]		
1/29	・リム P S M 又はアウトリガー P S M ; その準備 [2 0 1 2 . 0 1]		
1/30	・交互 P S M , 例. 渋谷・レベンソン P S M ; その準備 [2 0 1 2 . 0 1]		
1/32	・減衰 P S M [a t t - P S M], 例. ハーフトーン P S M 又は半透明な位相シフト部を有する P S M ; その準備 [2 0 1 2 . 0 1]		
1/34	・フェーズ・エッジ P S M , 例. クロムレス P S M ; その準備 [2 0 1 2 . 0 1]		
1/36	・近接効果補正に特徴を有するマスク; そ		

G 0 3 F

1/78	・ ・ ・ 荷電粒子線 [C P B], 例 . 電子線 , によるもの [2 0 1 2 . 0 1]	7/016	・ ・ ・ ジアゾニウム塩又は化合物 (G 0 3 F 7 / 0 7 5 が優先) [5]
1/80	・ ・ エッチング [2 0 1 2 . 0 1]	7/021	・ ・ ・ 高分子ジアゾニウム化合物 ; 高分子添加剤 , 例 . 結合剤 [5]
1/82	・ ・ 補助的なプロセス , 例 . クリーニング [2 0 1 2 . 0 1]	7/022	・ ・ キノンジアジド (G 0 3 F 7 / 0 7 5 が優先) [5]
1/84	・ ・ ・ 検査 [2 0 1 2 . 0 1]	7/023	・ ・ ・ 高分子キノンジアジド ; 高分子添加剤 , 例 . 結合剤 [5]
1/86	・ ・ ・ 荷電粒子線 [C P B] によるもの [2 0 1 2 . 0 1]	7/025	・ ・ 炭素 - 炭素三重結合を有する非高分子光重合性化合物 , 例 . アセチレン化合物 (G 0 3 F 7 / 0 7 5 が優先) [5]
1/88	・ レリーフ状原稿作成のために写真プロセスによって準備されたもの [2 0 1 2 . 0 1]	7/027	・ ・ 炭素 - 炭素二重結合を有する非高分子光重合性化合物 , 例 . エチレン化合物 (G 0 3 F 7 / 0 7 5 が優先) [5]
1/90	・ モンタージュプロセスによって準備されたもの [2 0 1 2 . 0 1]	7/028	・ ・ ・ 増感物質をもつもの , 例 . 光重合開始剤 [5]
1/92	・ 印刷表面から準備されたもの [2 0 1 2 . 0 1]	7/029	・ ・ ・ 無機化合物 ; オニウム化合物 ; 酸素 , 窒素又は硫黄以外の異種原子をもつ有機化合物 [5]
3/00	色分解 ; 色調の修正 (写真的複写装置一般 G 0 3 B)	7/031	・ ・ ・ ・ グループ G 0 3 F 7 / 0 2 9 に含まれない有機化合物 [5]
3/02	・ 手工修正によるもの	7/032	・ ・ ・ 結合剤をもつもの [5]
3/04	・ 写真的手段によるもの	7/033	・ ・ ・ ・ 結合剤が炭素 - 炭素不飽和結合を含む反応のみによって得られた重合体であるもの , 例 . ビニル重合体 [5]
3/06	・ ・ マスキングによるもの	7/035	・ ・ ・ ・ 結合剤がポリウレタンであるもの [5]
3/08	・ 光電的手段によるもの	7/037	・ ・ ・ ・ 結合剤がポリアミド又はポリイミドであるもの [5]
3/10	・ 分解ネガまたはポジの色または調子のチェック	7/038	・ ・ 不溶性又は特異的に親水性になる高分子化合物 (G 0 3 F 7 / 0 7 5 が優先 ; 高分子アジド G 0 3 F 7 / 0 1 2 ; 高分子ジアゾニウム化合物 G 0 3 F 7 / 0 2 1) [5]
5/00	スクリーン法 ; そのためのスクリーン	7/039	・ ・ 光分解可能な高分子化合物 , 例 . ポジ型電子レジスト (G 0 3 F 7 / 0 7 5 が優先 ; 高分子キノンジアジド G 0 3 F 7 / 0 2 3) [5]
5/02	・ 投映方法によるもの (カメラ G 0 3 B)	7/04	・ ・ クロム酸塩 (G 0 3 F 7 / 0 7 5 が優先) [5]
5/04	・ ・ 網掛け効果の変化によるもの	7/06	・ ・ 銀塩 (G 0 3 F 7 / 0 7 5 が優先) [5]
5/06	・ ・ 絞り効果の変化によるもの	7/07	・ ・ ・ 拡散転写に用いられるもの [5]
5/08	・ ・ 平行線スクリーンの使用	7/075	・ ・ シリコン含有化合物 [5]
5/10	・ ・ 交差線スクリーンの使用	7/085	・ ・ 接着促進非高分子添加剤に特徴のある感光組成物 (G 0 3 F 7 / 0 7 5 が優先) [5]
5/12	・ ・ その他のスクリーン , 例 . 砂目スクリーン , の使用	7/09	・ ・ 構造の細部 , 例 . 支持体 , 補助層 , に特徴のあるもの (印刷版用支持体一般 B 4 1 N) [5]
5/14	・ 密着法によるもの	7/095	・ ・ ・ 2 つ以上の感光層をもつもの (G 0 3 F 7 / 0 7 5 が優先) [5]
5/16	・ ・ 灰色中間調スクリーンの使用	7/105	・ ・ ・ 可視像を形成するための物質 , 例 . 指示薬 , をもつもの [5]
5/18	・ ・ カラー中間調スクリーンの使用		
5/20	・ グラビア印刷用網掛けの使用		
5/22	・ 数枚のスクリーンの組合せ法 ; モアレの除去		
5/24	・ 多重露光 , 例 . 線写真とスクリーンの組合せ		
7/00	フォトメカニカル法 , 例 . フォトリソグラフィ法 , による凹凸化又はパターン化された表面 , 例 . 印刷表面 , の製造 ; そのための材料 , 例 . フォトレジストからなるもの ; そのため特に適合した装置 (特別の製造法のためのフォトレジスト構造を用いるもの , 関係箇所 , 例 . B 4 4 C , H 1 0 P 7 6 / 0 0 , H 0 5 K , を参照) [2 0 0 6 . 0 1]		
7/004	・ 感光材料 (G 0 3 F 7 / 1 2 , G 0 3 F 7 / 1 4 が優先) [5]		
7/008	・ ・ アジド (G 0 3 F 7 / 0 7 5 が優先) [5]		
7/012	・ ・ ・ 高分子アジド ; 高分子添加剤 , 例 . 結合剤 [5]		

調節信号の自動発生のためのシステム G
0 2 B 7 / 2 8) [4]

- 7/11 ・ ・ ・ 被覆層又は中間層，例．下塗層をもつもの [5]
- 7/115 ・ ・ ・ 真空焼付においてスクリーン効果又はより良い密着を得るための手段を有する支持体又は層をもつもの [5]
- 7/12 ・ スクリーン印刷版又は類似の印刷版，例．ステンスル，の製造
- 7/14 ・ コロタイプ印刷版の製造
- 7/16 ・ 塗布法；そのための装置（支持体材料への塗布一般 B 0 5 ；写真目的用支持体への感光組成物の塗布 G 0 3 C 1 / 7 4 ）
- 7/18 ・ ・ カーブした面への塗布
- 7/20 ・ 露光；そのための装置（複製用写真焼付装置 G 0 3 B 2 7 / 0 0 ） [4]
- 7/207 ・ ・ 焦点調節手段，例．自動焦点調節手段（位置合わせと焦点調節との組合わせ G 0 3 F 9 / 0 2 ；投影焼付装置の自動焦点調節手段 G 0 3 B 2 7 / 3 4 ；焦点調節信号の自動発生のためのシステム一般 G 0 2 B 7 / 2 8 ） [4]
- 7/213 ・ ・ 同一表面の異なる位置を同一パターンで同時に露光するもの（ G 0 3 F 7 / 2 0 7 が優先 ） [4]
- 7/22 ・ ・ 同一表面の異なる位置を同一パターンで逐次露光するもの（ G 0 3 F 7 / 2 0 7 が優先 ） [4]
- 7/23 ・ ・ ・ そのための自動的な手段 [4]
- 7/24 ・ ・ カーブした表面への露光
- 7/26 ・ 感光材料の処理；そのための装置（ G 0 3 F 7 / 1 2 ～ G 0 3 F 7 / 2 4 が優先 ） [3 ， 5]
- 7/28 ・ ・ 粉体画像を得るためのもの（ G 0 3 F 3 / 1 0 が優先 ） [5]
- 7/30 ・ ・ 液体手段を用いる画像様除去 [5]
- 7/32 ・ ・ ・ そのための液体組成物，例．現像剤 [5]
- 7/34 ・ ・ 選択的転写による画像様除去，例．剥離 [5]
- 7/36 ・ ・ グループ G 0 3 F 7 / 3 0 ～ G 0 3 F 7 / 3 4 に包含されない画像様除去，例．ガス流を用いるもの，プラズマを用いるもの [5]
- 7/38 ・ ・ 画像様除去前の処理，例．予熱 [5]
- 7/40 ・ ・ 画像様除去後の処理，例．加熱 [5]
- 7/42 ・ ・ 剥離又はそのための処理剤 [5]
- 9/00 原稿，マスク，フレーム，写真シート，表面構造または模様が作成された表面，の位置決めまたは位置合わせ，例．自動的なもの（ G 0 3 F 7 / 2 2 が優先；写真マスクの製造 G 0 3 F 1 / 0 0 ；複製用写真焼付装置用のもの G 0 3 B 2 7 / 0 0 ） [4]
- 9/02 ・ 自動焦点調節の手段と組合わせたもの（自動焦点調節一般 G 0 2 B 7 / 0 9 ；焦点